



NU-262 プラズマ誘起CVD装置 サムコ社製 PD-220N

登録ファイル



PDL (Process Data Log) ファイル ※必須です

(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、
成膜条件を入力してください)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>



成膜時の基板配置の撮影画像など
(ファイル形式 : .jpg, .png, .tiff) **必須ではありません**



添付ファイル



無し

原則、実施日毎の登録をお願いします。

- ・一日に複数のサンプルを作製した場合は、複数ファイルを同時に登録することを推奨します。
試料番号を入れるなど後で識別できるファイル名で保存し、登録ファイルへ一度に登録してください。
- ・**成膜の内容が大幅に異なる場合**は、別々に登録（連続登録）を行ってください。ユーザーの裁量で分け方を決めていただいて構いません。（連続登録：データ登録マニュアル[5/7]）

※ 登録開始を押して構造化が始まると、登録ファイルは追加・編集できません。

(追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください)

【成膜後、段差計NU-220,NU-261などで膜厚測定を行った場合】

PDLへ膜厚を入力し、登録するファイル名の末尾に、計測装置の装置番号を入れてください。 (ファイル名の例：20251001〇〇成膜_NU-220測定)
RDEデータ登録後に段差計で測定された場合は、以下担当者までご連絡ください。



お問い合わせ hata.chiharu.n5@mail.nagoya-u.ac.jp

ARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
データ登録担当：秦

2025/11/07